# GaN マイクロディスクにおける WGM 発振の解明に向けた UV 光ファイバープローブの開発

山梨大学 工学部先端材料理工学科 酒井 優

Fabrication of UV Optical Fiber Probe for Clarifying WGM Oscillation in GaN Microdisks

Masaru Sakai Faculty of Engineering, University of Yamanashi

GaNマイクロディスクは、六角形状の良質な窒化ガリウム(GaN)単結晶である。その 周回型光共振器としての構造とGaNのレーザー媒質としての性質から、ウィスパーリン グ・ギャラリー・モード(WGM)発振による鋭い発光スペクトルが得られることが知られ ている。しかし、WGM発振の詳細についてはこれまで明らかになっていなかった。本研 究では、GaNマイクロディスク内部のWGM光をエバネッセントカップリングによって 取り出すことでWGM発振の詳細を明らかにすることを目的として、光ファイバープロ ーブ(マイクロ光ファイバーカプラー)の作製を行った。GaNの発光は紫外線領域にあり、 従来の溶融延伸法では目的に合った光ファイバープローブが得られないことから、HFエ ッチングによりプローブを作製した。作製した光ファイバープローブを用いたWGM光 の観察により、WGM発振の周回方向に偏りがあることが明らかとなった。

GaN microdiscs are high-quality gallium nitride (GaN) single crystals with a hexagonal shape. Because of its structure as a orbital optical resonator and the properties of GaN as a laser medium, it is known that sharp emission spectra can be obtained by Whispering Gallery Mode (WGM) oscillation. However, the details of WGM oscillation have not been clarified so far. In this study, optical fiber probe (micro optical fiber coupler) was fabricated to clarify the details of WGM oscillation by extracting WGM light inside a GaN microdisk by evanescent coupling. Since GaN luminescence is in the ultraviolet region, a suitable fiber probe could not be obtained by the conventional melt-stretching method, the probe was fabricated by HF etching. Observation of WGM light using the fabricated optical fiber probe revealed that the WGM oscillation was unbalanced in the orbital direction.

## 1. はじめに

本研究で扱う GaN マイクロディスクは、分子線エピタキシー法によって作製される六 角形状の良質な窒化ガリウム(GaN)単結晶で、側面が六方晶 GaN の結晶面で構成される ことから正確に 120°の頂角を有する六角形となる(Fig.1(a,b))。その高い結晶性ゆえ、 GaN マイクロディスクは光が内部を全反射しながら周回する周回型光共振器として機能 する。その共振モードは Fig.1(c)に示すように:

• WGM : Whispering Gallery Mode

("ささやきの回廊")

- ・QWGM: Quasi-WGM (擬似 WGM)
- ・FPM: Fabry-Pérot Mode
  (ファブリ・ペロー型共振器)

の3種類が考えられる。一方で、GaN は利得媒 質であることから、光強励起下(ナノ秒光パル ス励起下)においてはレーザー発振様の発振ス ペクトルが得られる(Fig.2)。

これまでの研究により、この発振ピークが WGM または QWGM に起因する光共振器発振 であることが確認されている<sup>1)</sup>。しかし、測定 で得られた発振ピークが実際にどの共振モード に対応しているのか、1周回あたりの波の数は いくつなのか、など発振モードの基本的性質に ついては明らかになっていなかった。GaNマ イクロディスクは直径が 2~3µm と小さいこと から WGM の縦モード間隔が 5~10nm と広い ため GaN の利得幅の中に 1~2 モードしか存在 しないこと、考えられる空間モードが複数ある こと(Fig.1(c))、などが発振モードの特定を難 しくしている。発振スペクトルの散乱角度依存 性の測定結果と理論計算の比較より、励起光の 1パルス毎の WGM または QWGM の周回方向 (右回り/左回り)において統計的に偏りがある ことが予想されたが、憶測の域を出ていない<sup>2)</sup>。 レーザー発振であれば励起光1パルス毎に左右 どちらの周回方向が選択されることは想像に難 くないが、統計的には右回り:左回り=1:1 に近づくはずであり、この比が極端に偏る理由 は容易には見つからない。WGM 発振の周回光 を直接測定することが出来れば、共振モードの 特定や周回方向の偏りの解明につながると期待 される。

本研究では、GaN マイクロディスクにおい て観察される WGM 発振の発振モードを解明 するための、テーパ光ファイバー型の新しいマ イクロ光ファイバープローブを作製し実証する ことを目的としている。本研究で作製する光フ ァイバープローブを用いて GaN マイクロディ スクの WGM 発振を測定する模式図を Fig.3 に 示す。光ファイバーの中間部分を細線化して



Fig.1 (a,b) GaN マイクロディスクの電子顕 微鏡写真と、(c) 3つの共振モードの 模式図<sup>1)</sup>



Fig.2 発振ピークの一例<sup>1)</sup>



Fig.3 光ファイバープローブを用いた WGM 周回方向測定の模式図

GaNマイクロディスクに近接させることで、エバネッセントカップリングによって GaN マイクロディスク中のWGM発振の一部を光ファイバープローブ内に取り出して計測す る。これにより、左回り/右回りの発振をそれぞれ図中の観察②/観察③のように別々に 取り出すことが可能となる。励起光1パルス毎に観察①~③を同時に分光測定し、この測 定を六角形の複数の辺に対して行うことで、WGM発振の発振モードの解明を目指した。

## 2. 光ファイバープローブの作製

従来のテーパ光ファイバーは、Fig.4に 示すように溶融延伸法によって作製され る。この方法では細線化された部分は光フ ァイバーのクラッド成分が支配的となる。 本研究で扱う GaN の発光は UV 域のため、 コアが純粋石英の石英光ファイバーを用い る必要がある。その場合クラッドには何ら かのドーパントが含まれるため、従来の方



Fig.4 従来のテーパ光ファイバーの模式図

法では細線化された部分の光吸収が大きく発光の測定が出来ない。さらに、細線化した部 分の形状が直線的だと基板表面にあるGaNマイクロディスクに対してアクセスが出来ない。 そこで本研究では、基板表面のGaNマイクロディスクに近接できるように湾曲し(Fig.5 (a))、かつ、その先端部においてはコアが露出するような形で細線化された、テーパ光フ ァイバーを拡張した新しい光ファイバープローブを作製した。プローブ作製においては、 まず光ファイバーを湾曲させた状態で治具に固定し、緩衝フッ酸エッチングによって湾曲 した先端部分の細線化を行う(Fig.5(b))。なお、光ファイバーに何らかの応力がかかって いると、エッチング開始後すぐに光ファイバーが破断してしまう。そこで本研究では、エ ッチング前に光ファイバーの加熱処理を行い、湾曲させた際に生じる応力を取り除いた上 でエッチングを行った。これにより、Fig.5(c)に示すような、先端部において純粋石英コ アが露出した光ファイバープローブを作製することができた。Fig.6に実際に作製した光 ファイバープローブの写真を示す。





Fig.5 本研究で作製した光ファイバープローブの、(a) 光学測定 配置、(b) エッチング行程、(c) コアが露出したプローブ 先端部とマイクロディスク、の各模式図

Fig.6 作製した光ファイバープ ローブ(エッチング前)

#### 3. 光学測定と測定結果

Fig.7に示すような光学測定系を構築し、 作製した光ファイバープローブを用いて GaNマイクロディスクのWGM発振の測 定を行った。光源には、波長355nm、パ ルス幅5ns、繰り返し1kHzのパルスレー ザーを用いた。自作パルスピッカーにより、 繰り返しを14Hzまで下げることで、1パ ルス毎の測定を可能とした。励起光(青色 のライン)は、50倍のUV対物レンズを通 して試料に照射した。試料からの発光は、 1パルス毎に3方向への発光を同時に分光 器で測定した。3方向とは、試料の上方向 への散乱光(緑色のライン)、光ファイバー プローブのSide A 方向(紫色のライン)、



Fig.7 測定系の概略図

および Side B 方向(朱色のライン)、の3つである。測定結果の一例を Fig.8 に示す。

本測定では、GaNマイクロディスクに対して光ファイバープローブを右側から近付け た。これにより、ディスク内の右回りWGMによる発光がSide A方向に、左回りWGM による発光がSide B方向に観察される。Fig.8(a)は、励起光70パルスの積算で得られた、 3つの各方向への発光スペクトルである。Side A、Side B、上方向への散乱光の3スペク トルとも、371nmと376nmに発振ピークが観察された。続いて、これらのピークの周回 方向特性を調べるために1パルス測定を行った。測定結果をFig.8(b)に示す。この図では、 1パルス毎にSide A方向とSide B方向で得られたスペクトルについて、371nmと376nm の各波長におけるピーク強度をXYプロットで示している。1点が1パルスに相当し、1000 パルスの測定結果を示している。波長371nmのピークについては、Side A 側に強く偏っ ていることがわかる。一方、波長376nmのピークについては、明確な周回方向の違いは みられなかった。これらの結果により、WGM発振の周回方向には偏りがあることが明ら



Fig.8 (a) 各方向の発光スペクトル(積算)と(b)1パルス測定による周回方向の分布

かとなった。WGM 発振の周回方向については、1パルス毎に右回りまたは左回りのどち らかの周回方向が選択されることは、利得の大きなモードに偏るという一般的なレーザー 発振の考え方で理解することができる。しかしその場合、周回方向はランダムに選択され るはずであり、右回りと左回りは1:1になるはずである。実験では、常にWGM 発振は 右回りの一方向のみで観察されており、その理由は現時点では明らかになっていない。一 方、周回方向の偏り方については、同じマイクロディスク内でも異なる波長(発振モード) では、偏り方の振る舞いが異なることが明らかとなった<sup>3</sup>。

# 4. まとめ

GaN マイクロディスク内部の WGM 光をエバネッセントカップリングによって取り出 すことで WGM 発振の詳細を明らかにすることを目的に、UV 領域で使用可能な光ファイ バープローブ(マイクロ光ファイバーカプラー)の作製を行った。作製した光ファイバープ ローブを用いた WGM 光の観察により、WGM 発振の周回方向には偏りがあり、偏り方は 同じマイクロディスク内でも波長によって異なることが明らかとなった。

## 5. 謝辞

本研究は、山梨大学大学院医工農学総合教育部修士課程工学専攻先端材料理工学コース の岩本優歌氏の協力により行われました。また、令和2年度(第42回)日本板硝子材料工 学助成会の研究助成を受けて行いました。同助成会に心より感謝申し上げます。

# 参考文献

- Lasing Action on Whispering Gallery Mode of Self-Organized GaN Hexagonal Microdisk Crystal Fabricated by RF-Plasma-Assisted Molecular Beam Epitaxy, T. Kouno, K. Kishino, and M. Sakai, IEEE J. Quantum Electron. 47, 1565-1570 (2011).
- Periodic Radiation Patterns and Circulating Direction of Lasing Light by Quasi Whispering Gallery Mode in Hexagonal GaN Microdisk, T. Kouno, S. Suzuki, M. Sakai, K. Kishino, K. Hara, J. Phys. Soc. Jpn. 85, 053401 (2016).
- 3) Investigation of the direction of rotation of WGM oscillation in hexagonal GaN microdisk, Y. Iwamoto, K. Kamiishi, A. Syouji, T. Kouno, A. Kikuchi, K. Kishino, and M. Sakai, The 13th Asia-Pacific Conference on Near-Field Optics (APNFO 13) PO 29-36, Hokkaido University (Sapporo, Japan), July 29-31, 2022.